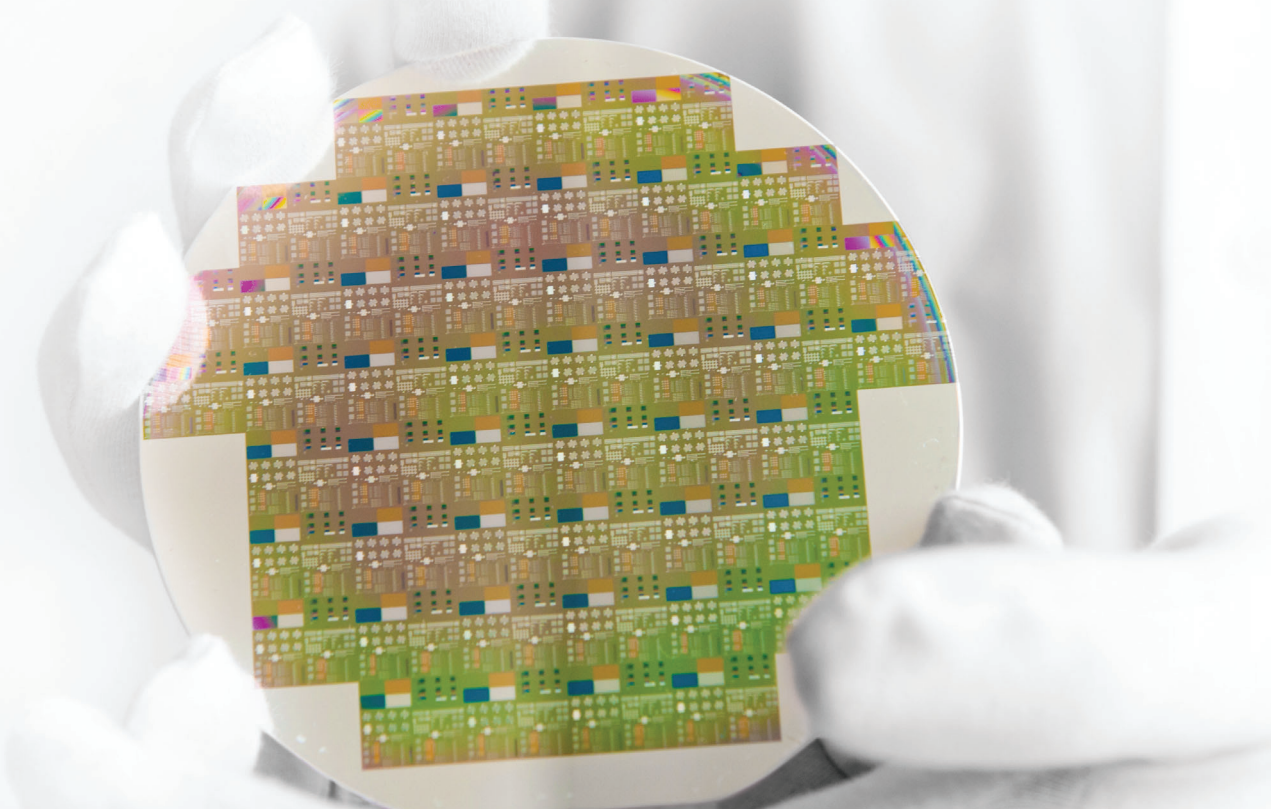





半导体制程应用



	制程	温度	环境工况	Fluorez® FFKM
 湿制程	晶圆清洗		Piranha SC-1 , SC-2 , HF , SPM	FC750W
	蚀刻	RT~200°C	HNO ₃ , HF , H ₃ PO ₄ , H ₂ O ₂ Acetic acid , BOE	FC750B FC600W
	光刻		H ₂ SO ₄ , NaOH , TMAH , NMP , DMSO , MEA , PGMEA	FC600B
 热制程	氧化/扩散		SiH ₂ Cl ₂ , N ₂ , NH ₃	FT750W FT750B
	LPCVD	150°C~300°C	O ₂ , N ₂ , HCl	FT600W
	热退火 RTP/Annealing		IR / Low outgassing	FT600W
 电浆制程	蚀刻		CF ₄ , C ₃ F ₈ , CHF ₃ , SF ₆ , BCl ₃ , HBr	FU650N FU750N
	灰化		O ₂ , CF ₄ , CHF ₃ , NH ₃	FC800TF
	PECVD HDPCVD SACVD	RT~300°C	N ₂ O , SiF ₄ , O ₂ , O ₃ , NF ₃ , CF ₄ TMS , TEOS , TEBO , NH ₃ , SiH ₄	FU650N FU750N
	PVD Metal CVD ALD		WF ₆ , SiH ₄ , H ₂ , N ₂ , O ₂ , TiCl ₄ , NF ₃ , Ar , Organic Precursors	FU800W